

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТОДОМ ЭПР СОБСТВЕННОГО МЕЖДОУЗЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КРЕМНИИ

© Г.О. Тожибаев, Ш.М. Махкамов, Ю.В. Горелкинский,
Н.А. Турсунов, М.А. Махов

Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана,
702132 Ташкент, Узбекистан

(Поступила в Редакцию 28 июня 1995 г.)

Методом ЭПР исследовано влияние предварительной термообработки кремния и последующего облучения протонами или α -частицами на образование собственных междуузельных дефектов в монокристаллическом кремнии. Показано, что центр Si-PK4 связан с термостабильным до 770 К комплексом междуузельных атомов кремния. Обнаружено и исследовано сверхтонкое взаимодействие от изотопа ^{29}Si . Предложена структурная модель дефектного центра Si-PK4, представляющего собой пару $\langle 001 \rangle$ -расщепленных собственных междуузельных атомов кремния.

Несмотря на большое количество экспериментальных работ по исследованию состояний дефектных центров в кремнии, до сих пор не имеется достаточной информации о собственных междуузельных дефектах. Среди большого числа дефектов, которые идентифицированы по сигналу ЭПР в облученном кремнии, только четыре центра (Si-G25, Si-A5, Si-B3 и Si-P6) связываются с собственными междуузельными комплексами кремния [1–6].

Центр Si-G25, обнаруженный после облучения n -типа кремния электронами с энергией 46 MeV при температуре 4.2 K, был отнесен к дефекту с гантельной конфигурацией $\langle 100 \rangle$, с отрицательным зарядовым состоянием и температурной стабильностью 170 K [2]. Центр Si-A5 авторы [3] связывают с комплексом, состоящим из двух эквивалентных собственных междуузельных атомов кремния со спином $S = 1$. Этот дефект отжигается при температуре 440 K. Для него была предложена модель двух расщепленных междуузлий, разнесенных на расстояние 9 Å. Центр Si-B3 — вторичный дефект, который формируется при отжиге 500 K в облученном нейтронами p -типа. Авторы [1, 4] заключили, что спектр Si-B3 соответствует либо $\langle 001 \rangle$ -двойному, либо $\langle 001 \rangle$ -расщепленному междуузлию Si, расположенному в тетрапоре. Центр Si-P6 наблюдался в зонном кремнии после облучения нейтронами при комнатной температуре и отжигался или перестраивался

при температуре 440 К [5,6]. Из анализа g- и A-тензоров была предложена модель для дефекта Si-P6 как для положительно заряженного ⟨100⟩-расщепленного междоузлия кремния.

В настоящей работе представлены экспериментальное исследование влияния предварительной высокотемпературной обработки на формирование собственного междоузельного дефекта в кремнии при облучении высокоэнергетичными заряженными частицами и идентификация их методом ЭПР.

В исследованиях использовался ЭПР-спектрометр восьмимиллиметрового диапазона, температура образца при измерениях была 77 и 300 К. Образцы кремния зонной очистки с $\rho = 100 \Omega \cdot \text{см}$ облучались на циклотроне протонами или α -частицами при комнатной температуре с энергиями частиц 30 и 50 MeV соответственно. Плотность тока в пучке при облучении составляла $\sim 0.3\text{--}0.5 \mu\text{A}/\text{см}^2$. Измерения спектра ЭПР показали, что облучение предварительно термообработанного при $\sim 1270\text{--}1370$ К кремния приводит к регулярному появлению сигнала ЭПР центра Si-PK4 даже после облучения сравнительно малыми флюенсами протонов ($\sim 10^{15} \text{ см}^{-2}$).

Спектр ЭПР, обусловленный центром Si-PK4, обнаружен ранее в зонном кремнии [7] после облучения большими флюенсами быстрых

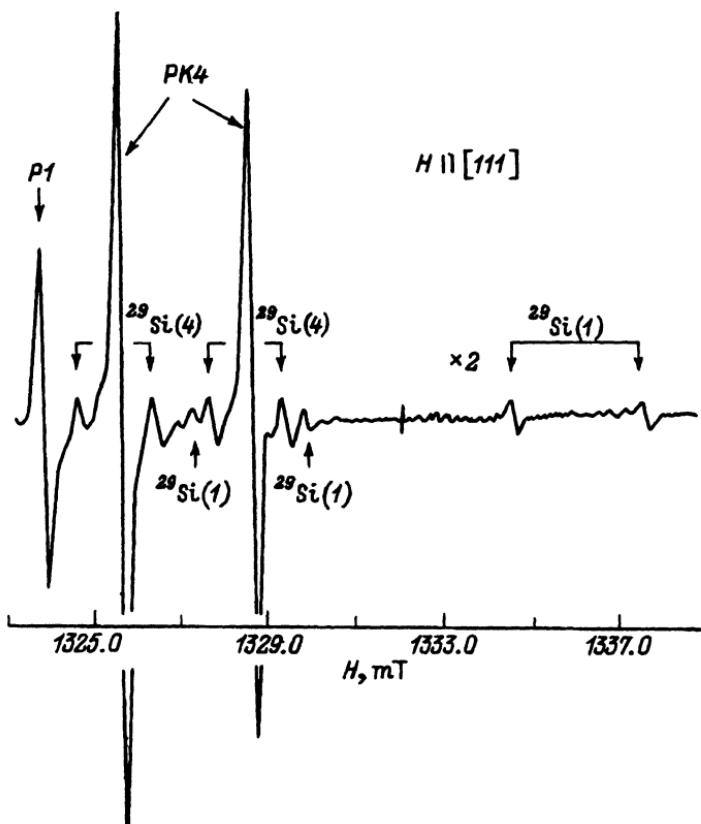


Рис. 1. Спектр ЭПР центра Si-PK4.

Стрелками показаны СТС от изотопа ^{29}Si . $\gamma_0 = 37.104 \text{ GHz}$; $T = 300 \text{ K}$.

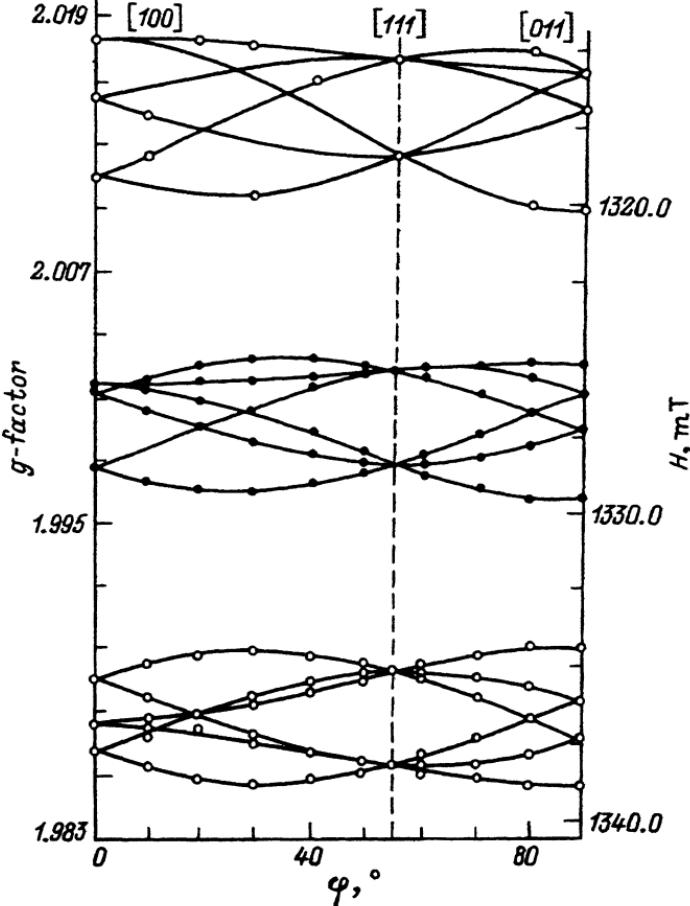


Рис. 2. Угловая зависимость спектра Si-PK4.

Точки — эксперимент, линии — результаты вычислений с использованием констант г- и А-тензоров из таблицы.

нейтронов ($\sim 10^{17} \text{ см}^{-2}$). Дефект, ответственный за этот спектр ЭПР, со спином $S = 1/2$ имеет симметрию C_2 , формируется после отжига образцов кремния при $\sim 470\text{ K}$ и проявляет стабильность до 780 K . Однако природа этого центра до сих пор оставалась неизвестной, поскольку его появление было нерегулярным в ряде кристаллов зонного кремния [7]. К тому же в работах [1,3,8] при тех же условиях облучения и отжига этот дефект не регистрировался. В данной работе путем варьирования режима термообработки и флюенса облучения удалось оптимизировать интенсивность сигналов этого центра и выделить в спектре ЭПР сверхтонкие спутники (СТС) от изотопа ^{29}Si . Кинетики формирования центра Si-PK4 в облученных протонами или α -частицами образцах очень близки, а в образцах кремния, выращенных по Чохральскому, центр Si-PK4 не наблюдался независимо от условий предварительной термообработки и типа легирующей примеси.

Спектр Si-PK4 с компонентами СТС при 300 K приведен на рис. 1. Как видно из этого рисунка, в спектре наблюдаются интенсивная цен-

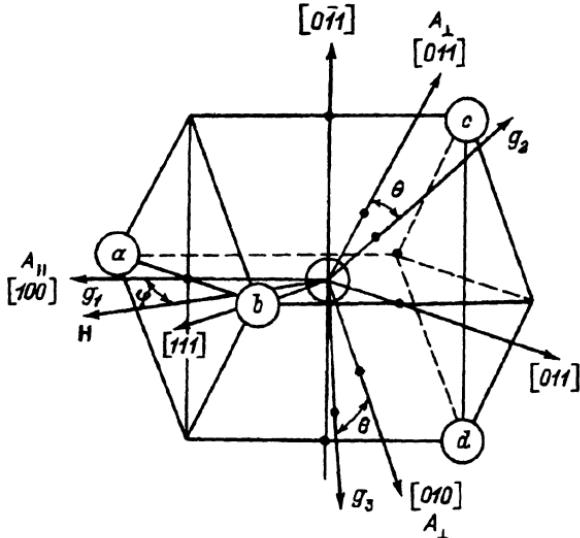


Рис. 3. Направления осей g - и A -тензоров для одной из эквивалентных ориентаций дефекта.

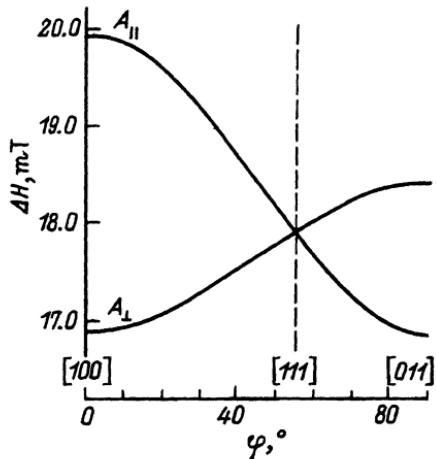


Рис. 4. Угловая зависимость сильного СТВ от одного атома ^{29}Si .

центральная группа линий и более слабые сателлиты, обусловленные СТС от ^{29}Si , природное содержание которого составляет 4.7 %. Этот спектр связывается с анизотропным дефектом, который имеет несколько эквивалентных ориентаций в кубической решетке кремния со спиновым гамильтонианом

$$\mathcal{H} = \mu_B \mathbf{H} \mathbf{g} \mathbf{S} + \sum_j \mathbf{I}_j \mathbf{A}_j \mathbf{S}_j, \quad (1)$$

где μ_B — магнетон Бора, \mathbf{S} , \mathbf{I} — спин электрона и ядра данного дефектного атома соответственно, \mathbf{H} — внешнее магнитное поле, \mathbf{g} и \mathbf{A} — симметричные тензоры второго ранга. Первый член описывает положение центральных линий, которые в зависимости от ориентации магнитного поля приведены на рис. 2. Второй член в (1) отражает сверхтонкое взаимодействие ядер соседних атомов с дефектом.

На основе экспериментально полученных ЭПР-спектров были выполнены измерения компонент A - и g -тензоров в системе кубических осей с последующей диагонализацией g -тензора. Из угловой зависимости СТС определены главные значения A - и g -тензоров, которые приводятся в таблице и на рис. 3.

Анализ СТС от ^{29}Si (рис. 1, 2) показал, что существуют три группы линий, отношение интенсивностей которых к амплитуде центральной группы линий равно $\sim 2.4\%$ и 10% , что свидетельствует о принадлежности этих сателлитов одному и четырем эквивалентным атомам кремния соответственно. Причем существуют два атома кремния в узловых положениях, вызывающих СТС от одного и того же атома ^{29}Si — сильное и слабое расщепление (рис. 1). Здесь важно отметить, что тензор сильного сверхтонкого взаимодействия (СТВ) от ^{29}Si , которому принадлежит основная часть волновой функции (Ψ) парамагнитного

\mathbf{g} -тензор (± 0.0002)	\mathbf{A} -тензор (± 0.5 MHz)			α_j^2	β_j^2	η_j^2	$\sum \eta_j^2$
$g_1 = 2.0017$	^{29}Si	\mathbf{A}_{\parallel}	\mathbf{A}_{\perp}				
$g_2 = 2.0032$	(1)	557.7	471.2	0.30	0.70	0.41	0.41
$g_3 = 1.9957$	(1)	82.7	70.0	0.31	0.69	0.06	0.06
$\theta = 31.2^\circ$	(4)	53.1	44.9	0.32	0.68	0.04	0.16

центра, имеет строго тетрагональную симметрию \mathbf{A} -тензора (рис. 4), т. е. \mathbf{A} -тензор аксиально-симметричен относительно оси (001).

Так же как это было сделано для других дефектов в кремнии [9], мы провели анализ \mathbf{A} -тензоров СТВ в рамках одноэлектронной ВФ неспаренного электрона, которая представляется в виде линейной комбинации $3s3p$ -атомных орбиталей, локализованных на атомных узлах, входящих в структуру дефекта:

$$\psi_j = \sum \eta_j (\alpha_j \varphi_{3s}^j + \beta_j \varphi_{3p}^j). \quad (2)$$

Здесь η_j^2 представляет вклад в СТВ j -го узла и нормируется как $\alpha_j^2 + \beta_j^2 = 1$, где α_j^2 и β_j^2 отражают относительные веса s - и p -составляющих этой орбитали.

Главные значения аксиально-симметричного \mathbf{A} -тензора задаются следующим образом:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{\parallel}(j) &= a_j + 2b_j, \\ \mathbf{A}_{\perp}(j) &= a_j + b_j \end{aligned} \quad (3)$$

с изотропным вкладом СТВ

$$a_j = \frac{16}{3} \Pi (\mu_j / I_j) \mu_B \alpha_j^2 \eta_j^2 \left| \varphi_{3s}(0) \right|_j^2 \quad (4)$$

и с анизотропным вкладом СТВ

$$b_j = \frac{4}{5} (\mu_j / I_j) \mu_B \beta_j^2 \eta_j^2 \langle r_{3p}^{-3} \rangle_j. \quad (5)$$

Здесь μ_j и μ_B — электронный и ядерный магнитные моменты соответственно, I_j — эффективный спин ядра, r — радиус-вектор электрона относительно ядра. Используя значения $\langle r_{3p}^{-3} \rangle = 16.1 \cdot 10^{24} \text{ см}^{-3}$ и $|\varphi_{3s}(0)|^2 = 31.5 \cdot 10^{24} \text{ см}^{-3}$ для кремния [9], находим, что 41 % ВФ парамагнитного электрона принадлежит одному атому кремния и только 16 % четырем эквивалентным атомам кремния (см. таблицу), что характерно для дефектов междуузельного типа [9]. ВФ парамагнитного электрона состоит из 30 % $3s$ - и 70 % $3p$ -состояний, демонстрируя больший вклад s -состояния, что не свойственно для дефектов вакансационной природы.

Используя метод, предложенный Ли и Корбетом [10], и учитывая наличие сдвига g -тензора от g_0 , можно предположить, что центр Si-*PK4* соответствует дефекту в положительном зарядовом состоянии. Ширина линии центра Si-*PK4* при 77 и 300 К равна 1.5 Г. Величины, как и направления, главных значений А- и g -тензоров меняются очень слабо в указанном диапазоне температур, а симметрия дефекта сохраняется. Но этот факт не исключает того, что C_2 -симметрия g -тензора дефекта возникает из-за ян-теллеровского искажения, в то время как ось А-тензора сохраняет $\langle 001 \rangle$ -аксиальную симметрию. Отсутствие в дефекте Si-*PK4* СТВ с осью симметрии, близкой к $\langle 111 \rangle$, позволяет уверенно исключить вакансационную природу этого дефекта, а его высокая температурная стабильность (до ~ 770 К) свидетельствует о том, что этот дефект соответствует комплексу междуузельных атомов кремния.

На основе полученных экспериментальных данных можно предположить, что структура исследуемого центра Si-*PK4* представляет собой пару $\langle 001 \rangle$ -расщепленных собственных междуузельных атомов (типа Si-*P6*). Возможность существования такой конфигурации недавно была предсказана в теоретической работе [11], посвященной природе междуузельных дефектов в кремнии.

Список литературы

- [1] Brower K.L. Phys. Rev. **B14**, 3, 872 (1976).
- [2] Watkins G.D. In: Lattice Defects in Semiconductors Ed. F.A. Huntley Inst. of Phys., London (1974). P. 1.
- [3] Lee Y.H., Kim Y.M., Corbett J.W. Rad. Eff. **15**, 77 (1972).
- [4] Daly D.F. J. Appl. Phys. **42**, 864 (1971).
- [5] Lee Y.H., Corbett J.W. Solid State. Commun. **15**, 1781 (1974).
- [6] Lee Y.H., Gerasimenko N.N., Corbett J.W. Phys. Rev. **B14**, 10, 4506 (1976).
- [7] Mu E., Wao J.C., Wu S.X., Yan M.X., Qin G.G. Phys. Lett. **A118**, 7, 347 (1986).
- [8] Lee Y.H., Brosious P.R., Corbett J.W. Rad. Eff. **22**, 169 (1974).
- [9] Lee Y.H., Corbett J.W. Phys. Rev. **134**, 1359 (1964).
- [10] Lee Y.H., Corbett J.W. Phys. Rev. **B8**, 6, 2810 (1973).
- [11] Myakenkaya G.S., Gutsev G.L., Gerasimenko N.N., Frolov V.V., Chubisov M.A., Corbett J.W. Rad. Eff. and Defects in Sol. **129**, 199 (1994).